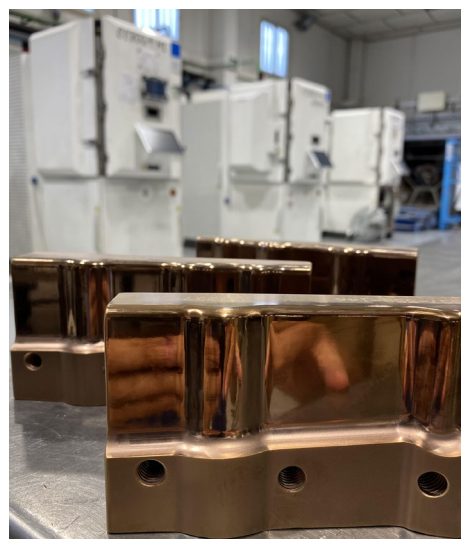


SILNITRON

ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK

Lurrunketa teknologia	PVD HiPIMS
Estalduraren materiala	TiAlSiN oinarrituta
Estalduraren lodiera	3-5 μm
Kolorea	laranja brontzea
Gogortasuna	3700HV
Deposizio temperatura	450-480°C
Lan. temperatura max.	1200°C



Estalduraren ezaugarriak

- (HiPIMS) dentsitate eta trinkotasun altua.
- (HiPIMS) zimurtasun baxua.
- Gogortasun oso altua.
- Erresistentzia itsaskorra.
- Tenperaturaren eta neke termikoaren aurkako erresistentzia altua

Aplikazio industrialak

HiPIMS teknologiak emandako ezaugarriek Silntron gainestaldura osoenatariko bat bihurtzen dute, beroan zein hotzan lan egiten duten eta higadura oso handia pairatzen duten piezetan erabiltzen dena.



 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING

RG-TCSN1